

## 1 半導体

### 1-1 抵抗率と導電率

長さ  $l$  [m]、面積  $S$  [ $\text{m}^2$ ] の均一な物質があるとする。

この物質の電気抵抗  $R$  は長さに比例し、断面積に反比例する。すなわち、このときの比例係数を  $\rho$  とすると、抵抗  $R$  は

$$R = \rho \frac{l}{S}$$

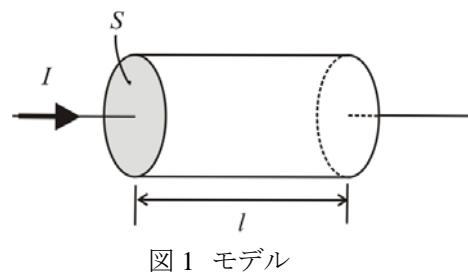


図 1 モデル

と表される。この係数  $\rho$  を「**抵抗率 resistivity**」といい、

単位は [ $\Omega\text{m}$ ] である。また、抵抗率の逆数を「**導電率 conductivity**」と呼ぶ。その単位は [ $\text{S}/\text{m}$ ] である(記号  $\sigma$ )。

物質に電界  $E$  [V/m] が掛かっている時に流れる電流密度を  $j$  [A/m<sup>2</sup>] とすると

$$E = j\rho = j/\sigma$$

の関係がある(オーム則)。

### 1-2 半導体

電気伝導の観点による物質の分類

#### 導体 conductor

電圧を印加すると容易に電流が流れる物質。例えば金属材料など。

特徴) 温度が高くなると抵抗率が増加  $\rho \propto T^5$  (T: 温度)

#### 絶縁体 insulator

金属に比べて極めて電流の流れにくい物質。例えば、ガラス、磁器、ゴム材料など。

特徴) 温度が高くなると抵抗率が減少  $\rho \propto \exp\left(\frac{\alpha}{T}\right)$  (T: 温度、 $\alpha$ : 定数)

#### 半導体 semiconductor

抵抗率がちょうど導体と絶縁体の中間をとる物質。例えば、Si、Ge など。

特徴) 温度が高くなると抵抗率が減少  $\rho \propto \exp\left(\frac{\beta}{T}\right)$  (T: 温度、 $\beta$ : 定数)

### 1-3 代表的な半導体

IV族元素半導体……Si(シリコン)：現在の半導体デバイスの主流

Ge(ゲルマニウム)：高周波信号用途

VI族元素半導体……Se(セレン)

化合物半導体(複数元素を組み合わせた半導体)

II-VI族化合物半導体……ZnO(酸化亜鉛)：紫外 LED 用

CdS(硫化カドミウム)：光センサ(使用されなくなってきた)

III-V族化合物半導体……GaAs(ガリウムヒ素)：高周波信号用途

InAs(インジウムヒ素)

GaN(窒化ガリウム)：青色 LED

表 1 半導体の歴史(関連する事項を含む)

年	人名	事項
1839	Faraday	硫化銀( $\text{Ag}_2\text{S}$ )の導電性、導電率の温度依存性
1822	Seebeck	熱起電力(ゼーベック効果) (熱電効果)
1834	Peltier	ペルチエ効果 (熱電効果)
1852	Thomson	トムソン効果 (熱電効果)
1873	Smith	Se で光導電効果(p.196) 光で導電率が変化
1874	Braun	$\text{PbS}$ 、 $\text{FeS}_2$ と金属針の接触で非オーム性(整流作用)
1874	Schuster	$\text{CuO}$ と $\text{Cu}$ の接触界面で整流作用
1876	Adams、Day	Se と金属の接触面で光起電力効果(p.197)
1904	Fleming	二極管
1906	de Forest	三極管
1924～	de Broglie Schrödinger Heisenberg	量子力学(半導体、固体物理学) 1926 年 シュレーディンガー波動方程式
1920	Grondahl	亜酸化銅整流器
1923	Presser	セレン整流器発表
1931	Wilson	トンネル効果による金属-半導体接触理論
1939	Mott	拡散理論による整流作用
1940	Schottky	ショットキーモデル
1942	Bethe	エミッション効果によるダイオード理論
1948	Bardeen、Brattain	点接触トランジスタの発明
1950	Shockley	接合型トランジスタの発明
1957	江崎	トンネルダイオード(エサキダイオード)
1958	TI 社	IC の第 1 号試作